

СКОРОСТЬ ПОВЕРХНОСТНОЙ РЕКОМБИНАЦИИ В ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СЛОЯХ СЕЛЕНИДА СВИНЦА

Анисимова Н. П., Глобус Т. Р., Олеск С. А.

Исследовано влияние скорости поверхностной рекомбинации на фотопроводимость и фотолюминесценцию поликристаллических слоев PbSe, прошедших термообработку в кислородосодержащей среде. Состояние поверхности необратимо изменяется при электризации образцов трением. В исходном состоянии скорость поверхностной рекомбинации в образцах с высоким уровнем фотопроводимости и фотолюминесценции менее 1 см/с.

В [1] были исследованы рекомбинационные процессы в тонких поликристаллических пленках селенида свинца, полученных методом термического испарения и прошедших термическую обработку в кислородосодержащей среде. Было установлено, что концентрационная зависимость времени жизни дырок τ_p , имеющая максимум в области концентрации $p=2 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$, количественно согласуется с моделью рекомбинации носителей через глубокий уровень, расположенный в нижней половине запрещенной зоны, с учетом межзонных излучательных переходов и оже-рекомбинации. Рекомбинационные центры, концентрация которых порядка $10^{17} \div 10^{18} \text{ см}^{-3}$, являются ловушками для электронов, так как коэффициент захвата электронов на несколько порядков выше, чем для дырок, и тем самым увеличивают на порядок время жизни дырок в пленках по сравнению с монокристаллами. Постоянная времени фотопроводимости τ_{ϕ} при этом равна τ_p . В соответствии с известными представлениями такими ловушками могут являться кислородосодержащие центры чувствительности. Физическая природа этих центров до настоящего времени не установлена, но, учитывая соотношение коэффициентов захвата электронов и дырок, можно предположить, что захват электронов происходит на притягивающий центр и, следовательно, глубокий уровень имеет донорный характер. При этом тип проводимости и концентрация дырок в поликристаллических пленках после термообработки определяются не центрами чувствительности, а преобладающим типом дефектов, вероятнее всего, вакансиями свинца. Таким образом, предельно высокие значения τ_p в пленках PbSe определяются концентрацией носителей, т. е. положением уровня Ферми относительно рекомбинационного уровня.

Однако, как показали исследования большого числа образцов, возможны существенно меньшие значения τ_{ϕ} по сравнению с предельными при тех же концентрациях дырок, что сопровождается уменьшением фотопроводимости. Как будет показано далее, диффузионные длины носителей заряда значительно превышают толщину пленки и размеры кристаллитов ($\sim 0.5 \text{ мкм}$). Поэтому можно предположить, что любые изменения электронных состояний на поверхности могут существенно сказываться на рекомбинационных процессах, уменьшая эффективное время жизни дырок. В то же время данные о скорости поверхностной рекомбинации в поликристаллических пленках селенида свинца практически отсутствуют. Известно только, что скорость поверхностной рекомбинации должна быть мала в пленках, имеющих высокую фотопроводимость [2].

Целью данной работы явилось исследование величины скорости поверхностной рекомбинации и ее влияния на фотопроводимость и фотолюминесценцию поликристаллических пленок PbSe, прошедших термообработку. Как и в ра-

боте [1]. исследования проводились на образцах холловской конфигурации, что позволило проводить контрольные измерения концентрации и подвижности носителей заряда.

Обычно для исследования свойств поверхности используется метод эффекта поля или метод газовых циклов. Однако метод эффекта поля в пленках PbSe не создает новых центров рекомбинации на поверхности, и происходящие изменения почти полностью обратимы. Другой метод исследования, связанный с адсорбционным воздействием молекул, атомов или ионов на поверхность, не дает желаемого эффекта, так как поликристаллические пленки PbSe, прошедшие термообработку, имеют достаточно плотную пленку окисла толщиной ~ 0.1 мкм, которая препятствует проникновению адсорбента к поверхности.

В процессе изготовления образцов было установлено, что любая операция, связанная с трением внешней поверхности пленки, приводит к заметному не-

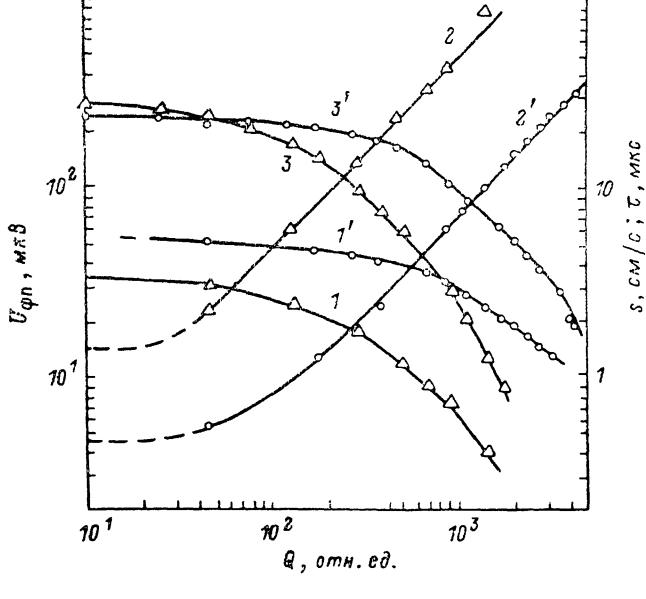


Рис. 1. Зависимость постоянной времени фотопроводимости $\tau_{\phi\pi}$ (1), скорости поверхностной рекомбинации s_p (2) и сигнала фотопроводимости $U_{\phi\pi}$ (3) от величины наведенного электрического заряда Q .

Номер образца: 1—3 — 1; 1'—3' — 2. $p \cdot 10^{-17}$, см $^{-2}$; 1—3 — 0.5; 1'—3' — 1.6; s_{p0} , см/с: 1—3 — 1.4; 1'—3' — 0.5; τ_0 , мкс: 1—3 — 3.7; 1'—3' — 5.3.

обратимому ухудшению фотоэлектрических параметров, главным образом к уменьшению фотопроводимости и интенсивности фотолюминесценции. Природа этого эффекта, вероятнее всего, связана с процессом электризации трением и с накоплением заряда в окисной пленке и на границе окисел—кристаллит. Прямые измерения потенциала наэлектризованной поверхности показали, что поверхность окисной пленки при трении заряжается положительно, а величина потенциала достигает сотен вольт. В зависимости от степени электризации или величины индуцированного заряда измерялось изменение холловских параметров, фотопроводимости, фотолюминесценции и постоянной времени фотопроводимости. Интенсивность фотолюминесценции измерялась при возбуждении излучением светодиода АЛ-107Б с длиной волны $\lambda = 0.9$ мкм импульсами с частотой 400 Гц. Постоянная времени определялась по спаду фотопроводимости аналогично работе [1].

В процессе накопления заряда при электризации образцов основные электрические параметры слоя, такие как концентрация и подвижность носителей заряда, а следовательно, и проводимость, изменились незначительно (не более 5–10 %), тогда как постоянная времени существенно уменьшалась, а фотопроводимость и фотолюминесценция падали в еще большей степени вплоть до полного исчезновения чувствительности и излучения. Эти результаты при-

ведены на рис. 1, 2. Такое уменьшение сигнала фотопроводимости и интенсивности фотолюминесценции, которое происходит при практически неизменной концентрации носителей заряда и сопровождается уменьшением постоянной времени, можно скорее всего объяснить возрастающим влиянием скорости поверхностной рекомбинации на границе окисел—кристаллит.

Время жизни, определяющее величину фотопроводимости с учетом скорости поверхностной рекомбинации s , можно получить следующим образом [3].

Уравнение непрерывности для электронов имеет вид

$$L^2 \frac{\partial^2 \Delta n}{\partial x^2} - \Delta n + I\tau_n = 0. \quad (1)$$

Здесь L — длина амбиполярной диффузии, I — объемный темп генерации неравновесных носителей светом, τ_n — время жизни электронов. Избыточные концентрации электронов Δn и дырок Δp связаны соотношением

$$\Delta p / \Delta n = \tau_p / \tau_n. \quad (2)$$

Решая уравнение (1) для пленки толщиной d с граничными условиями, учитывающими поверхностную рекомбинацию только на одной границе, т. е. $s=0$,

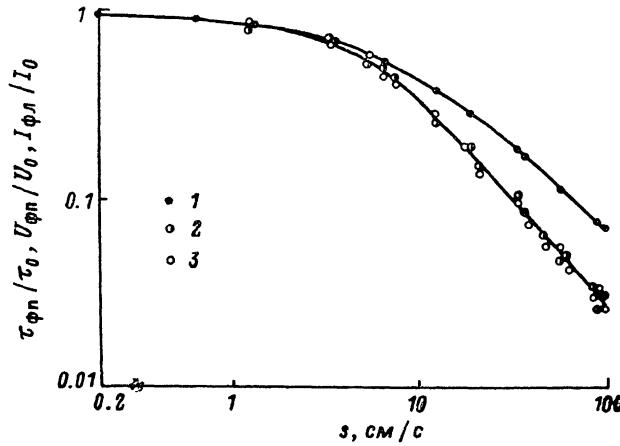


Рис. 2. Изменение постоянной времени $\tau_{\text{фп}}/\tau_0$ (1), сигнала фотопроводимости $U_{\text{фп}}/U_0$ (2) и интенсивности фотолюминесценции $I_{\text{фп}}/I_0$ (3) при увеличении скорости поверхностной рекомбинации s_p для образца 3.

$$p = 2 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}, \tau_0 = 5.2 \text{ мкс}.$$

при $x=0$ и $s_n \tau_n = s_p \tau_p$ при $x=d$, получим выражение для избыточной концентрации дырок, определяющей фотопроводимость,

$$\Delta p = \frac{I\tau_p}{1 + \tau_p s_p / d}, \quad (3)$$

справедливое только в случае достаточно тонкой пленки, когда длина амбиполярной диффузии носителей значительно превышает толщину пленки, так что процесс диффузии не лимитирует потока носителей к поверхности. Величина s связана со скоростью поверхностной рекомбинации электронов s_n и дырок s_p соотношением

$$s = \frac{(n + p) s_n s_p}{n s_n + p s_p}. \quad (4)$$

Из (3) следует выражение для времени фотопроводимости $\tau_{\text{фп}}$ в присутствии скорости поверхностной рекомбинации

$$\frac{1}{\tau_{\text{фп}}} = \frac{1}{\tau_p} + \frac{s_p}{d}. \quad (5)$$

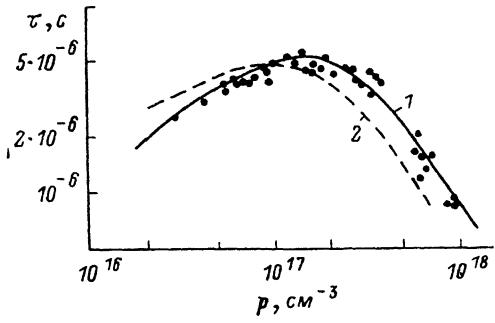
$$L^2 = \frac{kT}{q} \mu_n \mu_p \left(\frac{p\tau_p + n\tau_p}{p\tau_p + n\tau_p} \right), \quad (6)$$

тогда q — заряд электрона, дает при значениях времен жизни носителей $\tau_p \approx 5 \cdot 10^{-6}$ и $\tau_n = 10^{-7}$ с [1] и подвижностей $\mu_p = \mu_n \approx 50$ см²/В·с [4] значение $L \approx 6$ мкм, что на порядок превышает толщину слоя.

Таким образом, независимо от того, в какой точке внутри кристаллита происходит генерация неравновесных носителей, они могут легко достигнуть поверхности и рекомбинировать на ней. При этом из-за большого различия времен жизни дырок и электронов фотопроводимость определяется временем жизни и скоростью поверхностной рекомбинации дырок. В этом случае, чтобы получить величину скорости поверхностной рекомбинации дырок s_p , можно воспользоваться соотношением (5), считая, что $\tau_{\text{фп}}(s)$ является постоянной времени, характеризующей кинетику фотопроводимости в случае параллельно протекающих процессов рекомбинации.

Рис. 3. Зависимость постоянной времени фотопроводимости $\tau_{\text{фп}}$ от концентрации дырок p в поликристаллических слоях PbSe после термообработки.

Точки — экспериментальные значения. Расчетные кривые соответствуют концентрации центров $\cdot 10^{-17}$ см⁻³: 1 — 10, 2 — 1.



Полученная таким образом зависимость s_p от величины заряда для двух образцов приведена на рис. 1 (кривые 2 и 2'). Значения τ_p взяты из рис. 3 (кривая 1) по известным значениям концентрации. Исходное состояние пленок характеризуется величиной $s_p \leq 1$ см/с. С увеличением заряда Q зависимость s_p от Q переходит в линейную, при этом увеличение скорости поверхностной рекомбинации необратимо при комнатной температуре. Наблюдаемая линейная зависимость указывает, по-видимому, на то, что каждый заряд, наведенный при электризации трением, создает новое поверхностное состояние, которое действует как центр быстрой поверхностной рекомбинации. Альтернативное объяснение связано с возможностью такой перестройки электронных состояний на поверхности, которая приводит к изменению концентрации уже существовавших ранее центров захвата. Однако в этом случае трудно объяснить наблюдавшую линейную зависимость s_p от величины заряда, так как в рассматриваемой модели рекомбинации τ_p немонотонно зависит от концентрации центров M (рис. 3, кривые 1 и 2).

Как видно из рис. 2, интенсивность фотolumинесценции $I_{\text{фл}}$ уменьшается с увеличением s_p по тому же закону, что и фотопроводимость $U_{\text{фп}}$. При малых значениях s_p (< 5 см/с) эта зависимость совпадает с изменением $\tau_{\text{фп}}(s)/\tau_p = 1/(1+s_p\tau_p/d)$. Более быстрое уменьшение $I_{\text{фл}}$ и $U_{\text{фп}}$ по сравнению с $\tau_{\text{фп}}(s)$ при дальнейшем увеличении s_p указывает на то, что в этом случае из-за участия ловушек постоянная времени, определяющая кинетику процесса, не совпадает со стационарным временем фотопроводимости. Однако совпадение зависимостей на начальном участке кривых на рис. 2 позволяет сделать вывод о том, что поликристаллические слои селенида свинца после термообработки характеризуются малой скоростью поверхностной рекомбинации дырок $s_p \leq 1$ см/с. Электризация поверхности приводит к необратимому увеличению s и соответствующему изменению фотоэлектрических параметров.

Авторы благодарны Б. Л. Гельмонту за обсуждение и полезные замечания.

Л и т е р а т у р а

- [1] Анисимова Н. Н., Глобус Т. Р., Дийков Л. К., Калинин Ю. В., Николаева Т. Г., Олеск А. О. — ФТИ, 1983, т. 17, в. 3, с. 534—537.
- [2] Земел Дж. Н. — В кн.: Поверхностные свойства твердых тел. М., 1972, с. 317—428.
- [3] Равич Ю. И. Фотомагнитный эффект в полупроводниках и его применение. М., 1967. 95 с.
- [4] Анисимова Н. Н., Глобус Т. Р., Николаева Т. Г., Олеск А. О. — ФТИ, 1987, т. 21, в. 1, с. 39—42.

Получена 20.01.1987
Принята к печати 18.03.1988
